

显影液过滤及液体分离系统

Developer Separate System

- 可分离各种液体
- 分子量处理范围 500~10,000
- 提升良率，维持显影液浓度稳定
- 节省成本，大幅降低显影液消耗
- 提升产速，减少保养周期与工时
- 节省大量用水及排水，降低厂务负担
- 自动清洗，浓度管理，使用效果及寿命有保障
- 可扩充各种功能满足生产条件
- 处理量 1~100 CMH
- 此系统已荣获 4 国专利



※ KOH 显影液

	过滤前	过滤后
导电度μs/cm	2277	2856
PH值(ph)	10.39	10.38
总溶解固体TDS(ppm)	1428	1138

※ NaOH 显影液

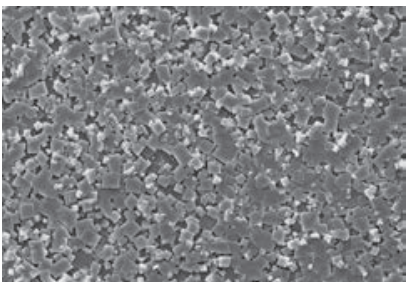
	过滤前	过滤后
导电度μs/cm	3860	3446
PH值(ph)	10.43	10.40
总溶解固体TDS(ppm)	1932	1728

※ Na₂CO₃ 显影液

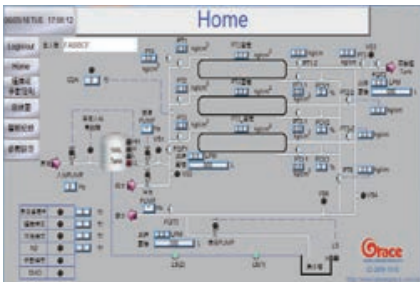
	过滤前	HP滤芯	UHP滤芯
导电度μs/cm	14970	14770	14580
PH值(ph)	11.01	11.01	11.01
总溶解固体TDS(ppm)	7480	7380	7290

※ 半导体化学研磨废液(CMP)

	过滤前	过滤后
砷(As)含量(mg/kg)	1260	661
镓(Ga)含量(mg/kg)	691	0
固含量(mg/g)	2.94	0.792



化学膜入水面 Na₂CO₃ 的结晶



操作介面



系统配置